

Siconnex BATCHSPRAY® Solvent 2.0: Eine Investition in die Zukunft.



Die neue Siconnex BATCHSPRAY® Solvent 2.0 kann Lösemittel verschiedenster Art prozessieren. Sie ist für Substratgrößen von 2" bis 12" erhältlich und mit der Siconnex BATCHSPRAY® Autoload kompatibel.



VORTEILE

- Für 2" bis 12" Substrate
- 25- oder 50-Wafer-Kammer erhältlich
- Linker oder rechter Rahmenanschlag wählbar
- Geringe Stellfläche durch nur dreiseitigen Servicezugang
- Kompatibel mit Autoload-Robotersystem
- Standardisierte Versorgungsanschlüsse
- Inline-Heizsysteme für Chemikalien
- Genaue Temperaturkontrolle durch Tankkühltheit
- High Flow Tank erhältlich
- Größeres Tankvolumen
- Bis zu vier Prozess Tanks konfigurierbar
- Direkte Prozessleitung für zusätzliche Chemiezufuhr
- Ausziehbare Prozesskammer für erleichterten Servicezugang



300 mm fähig



Prozessanwendungen:



CLEAN

- Polymer Clean
- Etch Residue Clean
- Post Ash Residue Clean



RESIST STRIP

- Positive Resist Strip
- Negative Resist Strip



RESIST DEVELOPING

- Photoresist Developing

BATCHSPRAY®
SOLVENT / 2.0

Siconnex BATCHSPRAY® Solvent 2.0 – ein Überblick.



BATCHSPRAY®

www.siconnex.com